PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-062808

(43)Date of publication of application: 29.05.1981

(51)Int.Cl.

CO8F112/36 CO8F 4/00

(21)Application number: 54-138717

(22)Date of filing:

29.10.1979

(71)Applicant:

HIGASHIMURA TOSHINOBU

(72)Inventor:

HIGASHIMURA TOSHINOBU

HASEGAWA HIROSHI

(54) POLYDIVINYLBENZENE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To polymerization of divinylbenzene in the presence of a specific anionic catalyst gives a novel type chain polyvinylbenzene soluble in organic solvent. CONSTITUTION: p- and/or m-Divinylbenzene is mixed with a nonpolar solvent such as benzene, preferably in an amount less than 20vol% and 0.05W100 millimol, per mol of divinylbenzene, of an anionic catalyst such as fluorosulfuric acid is added thereto. Then, it is made to react, preferably at 30W80° C to produce the objective chain polydivinylbenzene of formula I (M is formula II; X, Y are formula III; hydrocarbly residue between benzene rings in the main chain is formula IV). USE: The resultant polydivinylbenzene is soluble in solvents and used as a reactive plasticizer or a lubricant by hydrogenating the low polymer.

$$Y \xrightarrow{q} M \xrightarrow{q} X$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭56—62808

⑤Int. Cl.³C 08 F 112/364/00

識別記号

庁内整理番号 7919-4 J 7446-4 J 母公開 昭和56年(1981)5月29日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

匈ポリジビニルベンゼンおよびその製造方法

②特

願 昭54-138717

22H

願 昭54(1979)10月29日

の発 明 者

者 東村敏延 京都市左京区北白川伊織町35 ⑩発 明 者 長谷川洋

大阪市都岛区中野町3丁目1一

22

⑩出 願 人 東村敏延

京都市左京区北白川伊織町35

四代 理 人 弁理士 前島肇

明 細 書

1. 発明の名称

ポリツビニルベンセンおよびその製造方法

2. 特許 削求の範囲

(1) 一般式:

 $X \leftarrow M \rightarrow Y$

で示され、かつ式中、Mは

× および Y は、 簡一であることもある末端蓋であって、

であり、かつ主鎖中のペンセン核にはさまれた

炭化水素幾基は、

で示され、更に、 n は 0 もしくは」以上の整数であり、 n が 0 の場合には、式

で示される。鎖状ポリジピニルペンセン。

- (2) 前記ポリジピュルペンセンの末端二重結合以外の二重結合が主としてトランス結合である、特許請求の範囲第1項に記載のポリジピニルペンセン。
- (3) 前配M,XおよびYは、 p-ペンセン誘導体および/または m-ペンセン誘導体からなる基である、 特許請求の範囲第1項または第2項に記載のポリ リビニルペンセン。
- (4) スルホネートアニオンもしくは過塩素酸アニオンの存在下に、- 20°Cから+ 150°Cにおいて、 リビニルベンゼンを重合させることを特徴とする、 下配一般式:

x + m + y

- 1 -

で示され、かつ式中、 M は

x および y は、同一であることもある末端蓋であって、

であり、かつ主領中のペンゼン核にはさまれた 炭化水素残蓄は、

で示され、更に、 n は 0 もしくは 1 以上の整数であり、 n が 0 の場合には、式

- 3 -

他のモノマーとの共重合における橋かけ刻として 用いられており、それ自体のホモポリマー あるい はオリコマーとして知られているものは、次の一般 式(個)で示される化合物およびその橋かけ構造物で ある。

(式中mは1以上の整飲)

本発明者らは、スルホネートアニオンまたは過 塩素酸アニオンの存在下にグピニルペンゼンを重 合させることにより、ジピニルペンゼンの新規な 鎖状ポリマーまたはオリゴマーが得られることを 見い出し本発明を完成させたものである。

すなわち、本発明は下記の一般式 (1) であらわ されるポリジビニルペンセンに関するものである。

$$x \leftarrow M \rightarrow Y$$
 (1)

上記の一般式中、別は

C H2=C H - C H - C H - C H - C H 2

"で示される、鎖状ポリジピニルペンセンの製造方 法。

- (5) 前記ポリジピニルベンゼンの末端二重結合以外の二重結合が主としてトランス結合である、特許 請求の範囲第4項に配載のポリジピニルベンゼン の製造方法。
- (6) 前記ツビニルベンセンが、 p-ツビニルベンゼン および/または m-ツビニルベンゼンである特許精 求の範囲第4項または第5項に記載のポリツビニ ルベンゼンの製造方法。

3.発明の詳細な説明

本発明は、シピニルベンゼンの、有機溶解に可 密な鋭状のポリマーもしくはオリゴマー、および その製造方法に関するものである。

ジビニルベンゼンは、その分子中に2個のビニル基を有しているので、一般に重合により溶媒不 溶性の機かけ構造を持ったポリマーを生成するこ とが知られている。従って、ジビニルベンゼンは

- 4 -

X および Y は、同一であることもある末瀬碁であって、

であり、かつ主領中のペンゼン核にはさまれた 炭化水素残益は。

で示され、更に、 n は 0 も しくは 1 以上の整数であり、 n が 0 の場合には、 式

$$CH_{2}=CH$$

$$CH=CH-CH$$

$$CH=CH_{2}$$

$$CH=CH_{2}$$

$$CH=CH_{2}$$

で示される。

更に本発明は、スルホネートアニオンもしくは 過塩素酸アニオンの存在下に、温度-20°C から

- 6 -

+150°Cの範囲内でツビニルベンゼンを頂合させることを特徴とする前記式(!)であらわされるポリジビニルベンゼンの製造方法に関するものである。

本発明の製造方法について説明すると、原料の ジピニルベンセンとしては、p-およびm-ジピニル ベンセンのいずれを用いても良く、工業的には特 にこれらの異性体の混合物が有利に使用できる。

また、本発明の方法に使用するスルポネートアニオンは、RSO3 たる構造式で表わされる。ここでRは、フッ衆原子、塩素原子、脂肪族炭化水素残蓄、芳香族炭化水素残蓄なよびこれらの置換体である。前配脂肪族炭化水素残蓄の炭素数は1~3であり、芳香族炭化水素残蓄は単乗もしくは二環で、炭素数が6~18のものがそれぞれ好ましい。 遺換体は、アルキル置換体、ハロゲン置換体等が好ましい。

スルホネートアニオンの代表的具体例はつぎの とおりである。すなわち、Rがフッ宏原子の場合 のフルオロ鉄酸イオン、Rが塩素原子の場合のク

- 7 -

酸、ベンゼンスルホン酸無水物およびメタンスル ホン酸無水物等が代表的なものである。もちろん 酸の誘導体であるエステルおよび無水物は上記具 体例の化合物のみに限定されるものではない。

本発明の製造方法においては、また、過塩素酸
アニオン(CIO(T))の存在下で、前記式(I))で示さ
れる、ジピニルベンセンの数状ポリマーもしくは
オリコマーを合成することができる。この場合、
過塩素酸アニオンを生ずるいかなる化合物をも使
用することができるが、代表的なものは次のよう
な化合物である。すなわち、過塩素酸(HC1O4)、
過塩素酸アセチル(CH3COC1O4)、過塩素酸ブチリル
(C3 H7COC1O4)、ベンソイルパークロレイト

(◆ COC104) 等: 過塩素酸のオキソニウム塩、たとえば、ジオキソレニウムパークロレイト: 過塩素酸のトリフェニルメチル塩、すなわち、トリフェニルメチルパークロレイト(Pha C+C104-): および過塩素酸のトロピリウム塩のトロピリウムパークロレイト(C7H7+C104-) 等である。

使用する触媒量(スルホネートアニオンもしく

ロロ 硫酸イオンがあり、 Rが殷肪族炎化水無残器の場合はメタンスルホネートアニオン、 Rが芳香族炭化水素の場合には、 ペンセンスルホネートアニオン、 Rが置換件の場合には、 トリフルオロメタンスルホネートアニオンおよびパーフルオロエタンスルホネートアニオンなどがある。

これらのスルホネートアニオンを反応系に存在させて反応を進行させるには、酸(RSO₃ H)の形の化合物、あるいはこれらの酵導体である炭素数 1~3のアルキル茜(R')を有するエステル(RSO₃ R')もしくは(RSO₂)20で表わされる酸無水物の形の化合物を反応系に添加する。

スルホネートアニオン(RSOaT)を生成させる酸の代表的具体例は、フルオロ強酸、クロロ硫酸、トリフルオロメタンスルホン酸がよびパーフルオロエタンスルホン酸等である。また、エステルはこれらの酸のアルキルエステルであって、メチルエステルかよびエテルエステル等が代表的なものである。これらの酸の酸無水物は、ピロクロロ硫

- 8 -

は通塩素酸アニオンの使用量)は、シビニルベンゼン1 モルに対し、 0.05~100 ミリモルの範囲が好ましい。この範囲外の量でも使用できるが、少質では反応に長時間を要し、また必要以上に多量の触媒を使用した場合には、触媒除去に手間を要するので経済的に不利である。

反応温度は、-20°Cから+150°Cの温度 範囲内で任意に選択することができ、反応温度がこの温度範囲から外れた場合には、後述するように倒鏡にビニル基を有するポリマー(MI)が生じ、これは質に構かけ反応を惹起し、ポリマーは溶剤に不溶性となるので好ましくない。上記より更に好ましい反応速度は+30°Cから+80°Cである。

本発明の反応は、溶解の存在下で行なうことが 好ましい。溶解は一般にカチオン重合を停止させ ないものであればよい。溶解の好ましい具体例と しては、ペンセン、クロロペンセンのような芳香 族化合物、ローヘ中サンのような飽和脂肪 族炭化 水素、ンクロヘキサン、メテルシクロヘキサンの ような飽和脂環式炭化水素、あるいはこれらのハ □ ゲン化物である四塩化炭素、クロロホルム、トリクロロエタン等である。もちろん本発明に使用し得る溶媒はことに具体的に例示した化合物に限定されるものではない。また、溶媒は二種類以上を混合して用いることもできる。

なか、存媒の依性に関しては、無穏性かまたは 極性の低いものが良く、 使性の高い 辞媒を用いた 場合には側鎖にビニル書を有するポリマー(WI)を 生成し、例かけ反応が起りやすい。

更に本発明の製造方法においては、モノマーであるジピニルベンセンの機度が低い方が、式(個)のようなポリーマーを生じないので、たとえば、溶媒中のジピニルベンセンを 20 vol 5 以下にして使用することが好ましい。

本発明においては、以下に示すように、 ソビニルペンセン (里)をスルホネートアニオンまたは過塩素酸のような酸性触媒の存在下で重合させた場合、従来の方法とは異なり、プロトンの付加と配う 難を繰り返しながら、ソビニルペンセンの 2 つのビニル基が順次に結合し、その結果、主銭にフェニ

- 11 -

$$CH_{2} = CH \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH = CH$$

$$CH_{3} \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH = CH$$

$$CH_{3} \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH = CH$$

$$CH_{3} \longrightarrow CH = CH$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH=CH_{2} \longrightarrow CH_{2}=CH \longrightarrow CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH=CH_{2} \longrightarrow CH-CH=CH \longrightarrow CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH=CH_{2} \longrightarrow CH-CH=CH \longrightarrow CH$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH=CH_{2} \longrightarrow CH-CH=CH \longrightarrow CH$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH=CH_{2} \longrightarrow CH-CH=CH \longrightarrow CH$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH=CH_{2} \longrightarrow CH-CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH-CH=CH \longrightarrow CH-CH_{2}$$

$$CH_{2}=CH \longrightarrow CH-CH=CH \longrightarrow CH-CH_{2}$$

- 12 -

る。前記反応式では右端にプロトンが付加して反 応が進行する例を示した。この場合は構造式(VI) のポリマーが生成することになる。

また、上式の二量体(『)の左端にプロトンが付加すると、次の反応により三量体(VI)が生成する。

$$CH_{2} = CH \longrightarrow CH - CH = CH$$

$$CH_{3} \longrightarrow CH - CH = CH$$

$$CH_{2} = CH$$

$$CH_{3} \longrightarrow CH - CH = CH$$

$$CH_{3} \longrightarrow CH - CH = CH$$

- 14 -

特別昭56-62808(5)

なお、式(I)、(VI)なよび(VI)などの前配一般式(I)であらわされる本発明のポリマーもしくはオリゴマーにかける内部二重結合、すなわち、末端二重結合以外の二重結合は主としてトランス結合である。

また、タビニルベンゼンの異性体混合物、たと えばm-ジビニルベンゼンとp-ジビニルベンゼンと の混合物を取合させると、p-ジビニルベンゼンと m-ジビニルベンゼンのランダム共重合体が得られ、 る。

従来の塩化アルミニウムなどのカチオン重合触 様を用いてツピニルベンセンを重合すると、前記 モノマーカチオン(IV)はプロトン脱離をするといると なくさらにモノマーに付加するので、前記式(VII) のように偶額にピニル基を有するポリマーを生じ ることになる。ポリマー(VII)は 伽銀にピニル基を 持つために橋かけ反応を起しやすく、 溶剤に不容 性になるので好ましくない。

本発明の製造方法は、スルホネートアニオンま たは過塩素酸アニオンの存在下にジピニルペンゼ

- 15 -

ベンセン機能 0.10モル/ t、触機機能 0.50ミリモル/ t の初期条件で 70°Cで反応させた。所定時間後ア ンモニア性メタノールで反応を停止し、減圧下に 50°C で溶媒及び未反応モノマーを除去した。

上記反応において、反応時間10分後の転化率は30%であり、また30分後の転化率は95%であった。転化率30%のときの生成物は応動性の良い液体であり、95%のときの生成物はやや粘稠な液体であった。これらの生成物の分子量分布をゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定した。その結果を第1図に示す。第1図中、(a)は転化率30%における生成物についてのGPC曲線であり、同(b)は転化率95%における生成物についてのGPC曲線である。

第1図に示すように、転化率30%における生成物は、シピニルベンセンの二量体を44%含む平均重合度約3のオリゴマーであり、一方、転化率95%の生成物は、二量体から分子量約2000程度のものまでの分布を有するオリゴマーであった。生成物のNMRスペクトル分析により、二量体の構造は前

ンを重合させるのであるが、前述のように重合極度が-20°Cから+150°Cの速度範囲を外れるとき、モノマー機度が高いとき、また極性溶媒を用いるときには、式(値)の構造を有するポリマーが生成し、このポリマーは更に構かけ反応を起すので好ましくない。

なお、本発明のポリソビニルベンセンは、 密剤 可溶性であり、また分子中に活性な二重結合を有 する。 この性質を利用して、 そのままで、 もしく は末端二重結合を変性して反応性可塑剤として使 用することができ、 更に水素添加することにより、 分子量の低いものは潤滑油などに用いることがで きる。

以下に実施例により本発明を更に詳細に説明する。

実施例1

乾燥窒素中で市販のツビニルベンセン(p-ツビニルベンセン 70g、m-ツビニルベンセン 30gの. 混合物)のベンセン路液に、過塩素酸アセチル(CH₃ COC104)のベンセン路液に、過塩素酸アセチル

- 16 -

記椈造式([])、すなわち

$$CH_2 = CH$$
 $CH - CH = CH$ $CH = CH_2$

で示されるオリゴマーであり、分子量の大きいオリゴマーはp-ジピニルベンセンとm-ジピニルベンセンとm-ジピニルベンセンがランダムに重合した前記式(I)の構造を有するととが確認された。(化学シフト(δ)、

- CH₃: 1.4 ppm、三CH: 3.5 ppm、-CH=CH-: 6.5 ppm、 =C₆H₄: 7.2 ppm、末端ピニル基: 5 ~ 7 ppm)

また、内部二重結合はいずれもトランス結合で あり、二量体 および分子量の大きいオリゴマーは 共化ペンセン、四塩化炭素などの有機溶剤に可溶 であった。

実施例 2

実施例1と同様の反応条件において、ジビニルベンセン(p-体/m-体=70/30)を反応させた。モノマーの転化率が100をに建した点で、モノマーを新たに反応系に添加した。モノマーの添加回数を増加するに従い、生成物の分子量は大きくなっ

- 18 -

特開昭56-62808(6)

た。モノマーの添加を4回繰り返して得られた生成物は白色粉末状の固体であって、ベンゼンもしくは四塩化炭素などの有機溶媒に可存であった。 第2回にこの生成物の GPC曲 線を示す。同曲線に見られるように、生成物の平均分子量は3500 であった。

生成物の構造は NMR スペクトル分析の 結果、式(!) で示される化合物であることを確認した。 実施 例 3

実施例1かよび実施例2ではモノマーとして、 市販のツビニルベンゼン(p-かよび m-ツビニルベンゼン混合物)を使用したが、本実施例では、別途にp-ツビニルベンゼンを合成し、ポリマー(1)の合成を行なった。

実施例1と同様にモノマー漫度 0.10モル/と、反応温度 70°C で、トリフルオロメタンスルホン酸 (CP₃ SO₃ H)を触媒として、 30分間反応させだ。 触媒濃度は 1.0ミリモル/とであった。反応開始より 30 分後の転化率は約 98 %であり、生成物は実施例 1 に示したものと殆ど同様の分子量分布を示し、

- 19 -

のであるために、ベンセン、四塩化炭素などの有 般器剤には不辞であった。

。 4. 図面の簡単な説明

第1図(a) および第1図(b) は、それぞれ 夾胞 例1の転化率 30 % および 95 % における 重合生成 物の分子量分布を示す GPC 曲線であり、曲線の各ピークに付した数字は ジビニルベンゼンの重合度を示す。第2図は、機軸に分子量をとり、 実施例2における重合生成物の分子量分布を示した GPC 曲線である。

等許出頭人 束 村 敏 延 代理人 弁理士 前 島 肇 その化学構造は式(!)によって示される化合物であることがNMRスペクトルによって確認された。 比 較 例

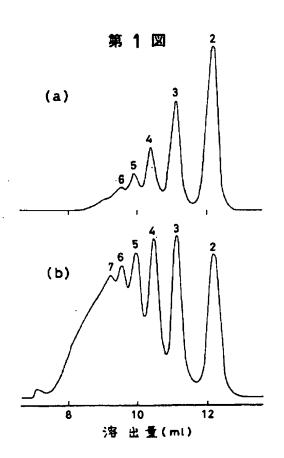
本発明の基本をなすものは、スチレン等の反応において、スルホネートアニオンまたは過塩素酸フニオンの存在下では、二量体が選択的に生成し、三量体は殆ど生成しないという知見に基づいてあって、ジビニルベンゼンは前配の反応式で示したように、プロトンの付加と脱離を繰り返し、ポリマー(1)が得られるのである。

従って、ことでは比較のために、従来からカチオン重合で一般に使用されているハロゲン化金属 触媒である三フッ化ホウ素エーテル競体を触媒と して反応をおとなった。

すなわち、実施例1と同様に、モノマー濃度 0.1モル/と、反応温度70°Cで、三フッ化ホウ素エーテル錯体(濃度1.0ミリモル/と)を使用して30分間 反応させた。転化率は60 g であった。

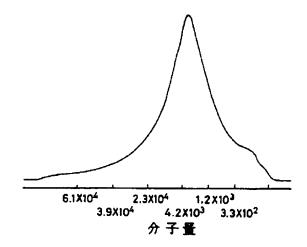
生成したポリマーは白色固体であり、前記式(VII) の構造を有するポリマーが高度に架橋しているも

- 20 -



- 21 -

第 2 図



昭和54年12月 3日

特許庁長官 川原能雄股

1. 事件の表示

昭和 54 年 **特許原第 138717 号**

- 2. 発明の名称
- ポリゾピュルペンセンおよびその製造方法 3. 補正をする者

事件との関係 券許出題人

ア・メナ (名称) 東 村 敬 延

4. 代 斑 人

但 所 東京都台東区上野 7丁目 11 番 7号 川村ビル 〒 110 電話 03(841)5861 〒 110 電話 03(841)5861 (8303) 弁理士 前 島 電

- 5. 補正命令の日付 (目発)
- 6. 補正により増加する発明の数 なし
- 7. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の関係で



8. 袖正の内容 別紙の通り

特顯昭 54-138717号

「ポリクピニルペンセンおよびその製造方法 」

捕正の内容

明細奪中、発明の詳細な説明の欄を以下の通り

- 1. 新 18 頁、下から第 12 行の「 ≡ C H 」を「- C H 」と
- 2. 第 18 頁、 下から第 11 行の「=C₆ H₄」を「フェニル蓋」 と訂正する。

以上